

AE 助力精准工艺控制再攀高峰

依托齐全的等离子体控制电源产品套件开拓工艺创新
— 来自脉冲电源技术的全球领先企业

数十年来，凭借在电弧预防、镀膜质量和产量方面的领先技术，AE 一直是脉冲电源技术的行业翘楚。今天，我们的脉冲产品套件代表最先进的技术，为用户提供各种强大的技术性能来开发新工艺与技术创新。

优势

- 杰出的的镀膜质量和产量
- 减少薄膜、基板和设备的损坏
- 在非常频繁的电弧条件下，提供稳定的产量和功率传送
- 易于集成，控制灵活

特点

- 提供最先进的直流脉冲技术
- 极低电弧形成率
- 性能稳健、可靠
- Arc Management System™ (AMS) 技术—客户可以针对金属和陶瓷靶材预设参数
- Set Point Compensation™ 技术—产量稳定

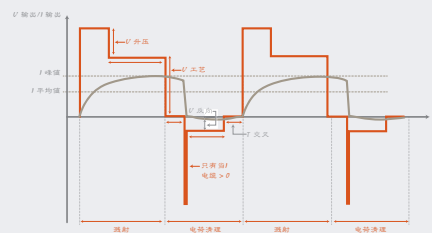


业内最先进的直流脉冲技术

- 可控电荷清理周期，有效抑制电弧形成
- 操作范围宽广，适用于各种材料
- 便捷的单箱解决方案，适合单靶磁控溅射

不久将推出单箱双靶磁控溅射解决方案

Ascent® AP 系列

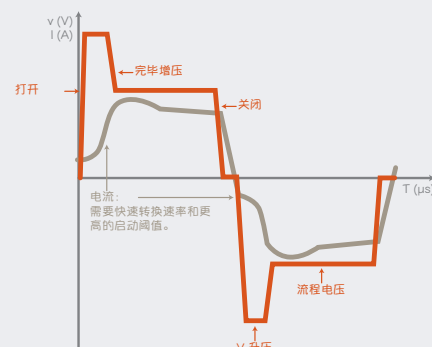


完美控制双靶磁控溅射

- 先进的电弧处理能力，提高稳定性
- 更高功率等级，减少电弧损害，提高产量和质量
- 频率可调，有助增加沉积时间
- 精准控制，有助实现可重复、定制薄膜

独立控制对每个磁控靶的功率传送，延长生产周期，减少靶材浪费

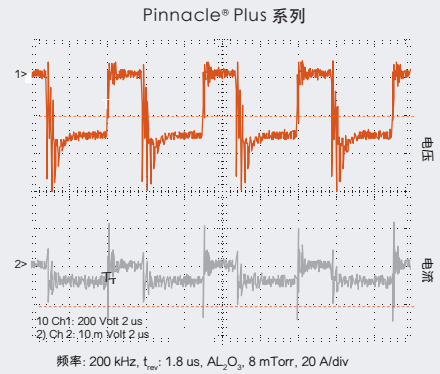
Ascent® DMS 系列



稳健、可靠的直流脉冲功率传送

- 可靠的电荷清理
- 可重复性能
- 卓越的薄膜质量

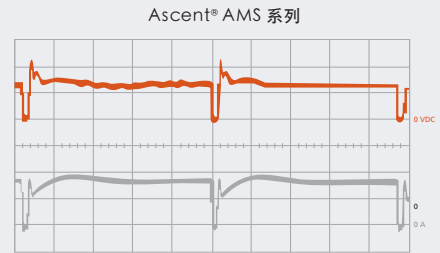
如今紧凑式 3U 设计扩展至低功耗操作，适合超薄敏感薄膜。



ARC MANAGEMENT SYSTEM® 技术现在用于直流脉冲中

- 5 kHz 脉冲嵌入标准直流套件中
- 行业领先的电弧检测、关断和功率恢复速度
- 可重复的功率传送，稳定的溅射率

将电弧预防与电弧处理相结合，提高低导电率靶材溅射稳定性，为新工艺开发保驾护航



5 kHz 脉冲, 10 μ sec 关闭

适合高精度低功率工艺的精准功率输出

- 适用于大面积镀膜系统薄膜沉积的创新解决方案
- 与传统低功率方法相比，明显提升薄膜均匀性和等离子体稳定性

使用各种用户可编程的开关时间，实现接近 2 kHz 的低功率脉冲输出



可以拓展和整合 AE 电源解决方案的同步脉冲

- 通过同步控制协调多个阴极
- 交叉技术集成选择

通过主/从配置实现更高功率等级。



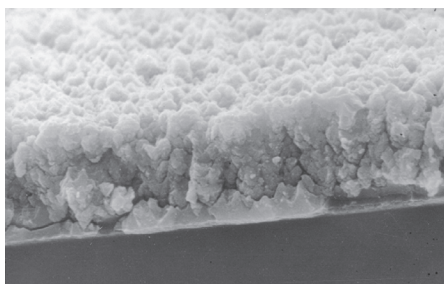
直流脉冲产品的优势

AE 的直流脉冲产品能最大限度地降低电弧形成，提高沉积率、薄膜平整度和堆积密度。

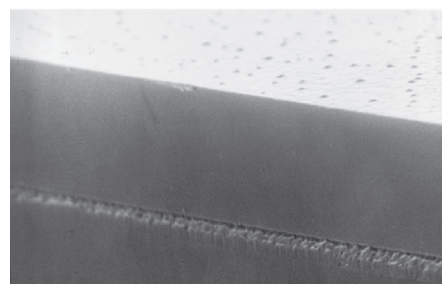
脉冲有助降低整个等离子体的有效电压，保持单个电子的实际电压，在多数电弧出现前便将其消除，维持高溅射率。

AE 产品采用最先进的直流脉冲技术，对高品质、定制薄膜和高产量提供前所未有的等离子体精度和工艺控制。

(图片来源：英国索尔福德大学先进材料与表面工程中心)



使用直流脉冲产品溅射 Al_2O_3



使用 AE 直流脉冲产品溅射 Al_2O_3

For international contact information, visit: advanced-energy.net.cn.

ZHO-PulsingPlatform-250-02 3.16

规格可能发生变化，恕不另行通知。©2016 Advanced Energy Industries, Inc. 版权所有。Advanced Energy®、Arc Management System™、Ascent®、Pinnacle® 和 Set Point Compensation™ 是 Advanced Energy Industries, Inc. 的商标。